

ユニークな基板加熱機構シリーズ

PVR(Professional Vacuum Research)
PVR(Professional Vacuum Research)

1. SiCヒーター加熱機構

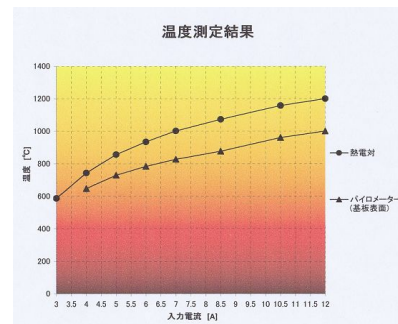
反応性ガス雰囲気中でも1000℃加熱が出来る方式です。レーザーアブレーション装置、スパッタ装置、CVD装置をはじめ、幅広い実績を有しています。大型基板でも温度分布のよい加熱が出来ます。また、ユニットのみとしても対応可能です。

・SiC基板回転過熱機構及びユニット実施例



【SiC基板加熱機構】

PLD、スパッタ装置で広く使用されています。
Φ1"~Φ4"迄シリーズ化されております。

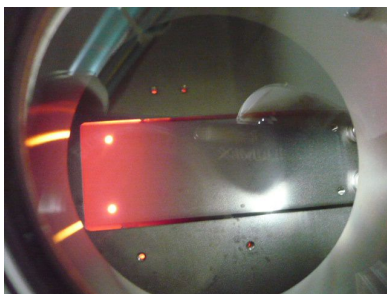


【1000℃加熱データ】

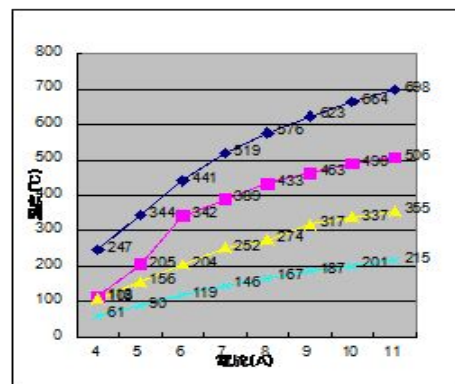


【Φ1"~Φ4"円形基盤用】

SiC及びリフレクターアッセンブリーユニット
として対応可能です。 ※写真はΦ3"円形基板用



【傾斜温度測定】

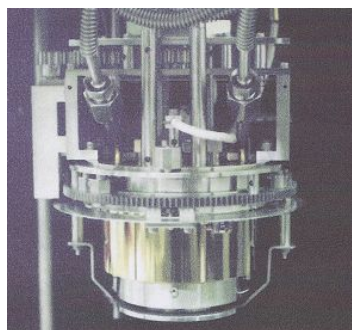


【温度傾斜データ(有)フリーダム様御提供】

2. ランプ加熱機構

高速昇温・降温加熱に最適です。光源にハロゲンランプを使用し、反射鏡に工夫を加え、超高真空中でも反応ガス雰囲気中でも1000°C加熱が出来ます。真空アニール装置、CVD装置、レーザーアブレーション(PLD)装置等に使われております。また、メンテナンスが容易で、安価である特徴を有しています。基板サイズとしてΦ1"~Φ2"迄対応可能です。

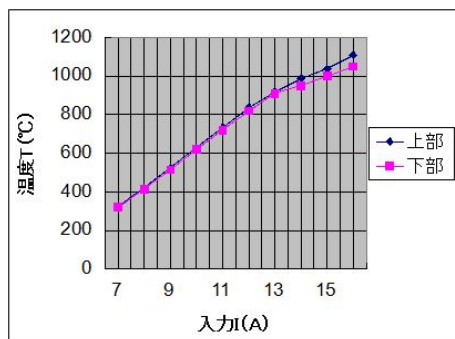
・ランプ基板回転加熱機構及びユニット実施例



【ランプユニット】



【ハロゲンランプ】

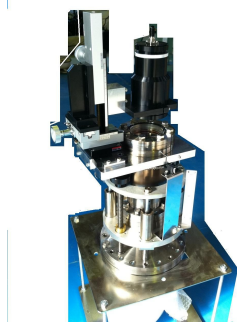


【1000°C加熱データ】

3. レーザー加熱基板機構

808nm固体レーザーを使用し、光学系及び真空中への光導入部に工夫を加えることで効率よく1000°C以上の加熱を行うことが出来ます。真空アニール装置他、より高温を必要とするプロセスに最適です。

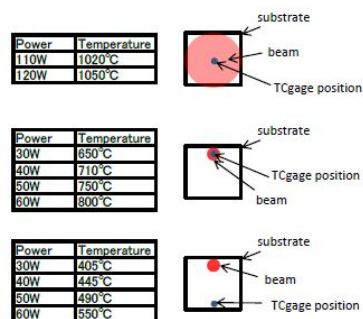
・実施例



【ユニット全景】



【レーザー電源】



【加熱テストデータ】

PVR(Professional Vacuum Research)

真空機器技術コンサルティング

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-26-2

TEL・FAX: 027-226-5491

E-mail: tetsuomaebashi@yahoo.co.jp

URL : <http://www.pvr-ishida.com/>
